

SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING IT

Publication number: JP2001210833 (A)

Publication date: 2001-08-03

Inventor(s): MAEKAWA SHINJI; NAKAZAWA MISAOKO

Applicant(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Classification:

- international:

G02F1/136; G02F1/1368; G09F9/30; H01L21/20; H01L21/3205; H01L21/336;
 H01L21/8238; H01L23/52; H01L27/08; H01L27/092; H01L27/32; H01L29/423;
 H01L29/43; H01L29/49; H01L29/786; G02F1/13; G09F9/30; H01L21/02;
 H01L21/70; H01L23/52; H01L27/08; H01L27/085; H01L27/28; H01L29/40;
 H01L29/66; (IPC1-7): H01L29/786; G02F1/1368; G09F9/30; H01L21/20;
 H01L21/3205; H01L21/336; H01L21/8238; H01L27/08; H01L27/092; H01L29/43

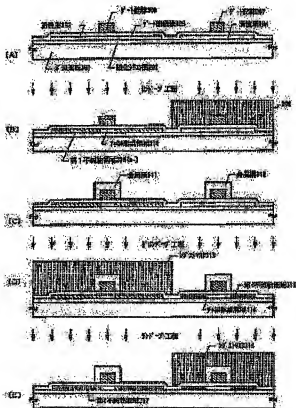
- European:

Application number: JP20000350612 20001117

Priority number(s): JP20000350612 20001117; JP19990328785 19991118

Abstract of JP 2001210833 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly reliable semiconductor device. **SOLUTION:** This highly reliable semiconductor device is constituted in such a way that metallic films are caused to be deposited on the side face and top face of gate wiring by electroplating in a GOLD structure in which the metallic films are superposed upon an LDD area through a gate insulating film.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-210833

(P2001-210833A)

(43) 公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	レーマコード [*] (参考)
H 0 1 L 29/786		G 0 9 F 9/30	3 3 8
G 0 2 F 1/1388			3 6 5 Z
G 0 9 F 9/30	3 3 8	H 0 1 L 21/20	
	3 6 5	27/08	3 3 1 E
H 0 1 L 21/20		29/78	6 1 7 L

審査請求 未請求 請求項の数18 O L (全 23 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-350612(P2000-350612)

(22) 出願日 平成12年11月17日(2000.11.17)

(31) 優先権主張番号 特願平11-328785

(32) 優先日 平成11年11月18日(1999.11.18)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 前川 慎志

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 仲沢 美佐子

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

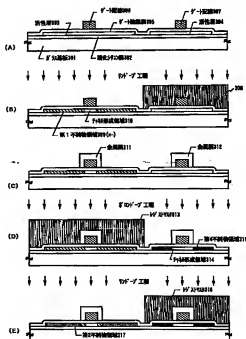
導体エネルギー研究所内

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその作製方法

(57) 【要約】

【課題】 信頼性の高い半導体装置を実現することを目的とする。

【解決手段】 ゲート配線の側面および上面に電解めっき法により金属膜を析出させ、この金属膜をゲート絶縁膜を介してLDD領域と重ねたGOLD構造にすることにより、信頼性の高い半導体装置を実現する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ゲート絶縁膜上にゲート配線を有し、

前記ゲート配線の側面および上面に膜厚の等しい金属膜を有しているTFTを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】ゲート絶縁膜上にゲート配線を有し、

前記ゲート配線の側面および上面には電解めっき法によって析出させた金属膜を有しているTFTを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項3】nチャネル型TFTおよびpチャネル型TFTで形成されるCMOS回路を有する半導体装置において、

前記nチャネル型TFTおよび前記pチャネル型TFTは、ゲート絶縁膜上にゲート配線を有し、

前記ゲート配線は、側面および上面に金属膜を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項4】nチャネル型TFTおよびpチャネル型TFTで形成されるCMOS回路を含む半導体装置において、

前記nチャネル型TFTおよび前記pチャネル型TFTのそれぞれの活性層上にゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線と、前記ゲート配線の側面および上面を覆う金属膜と、を有し、

前記nチャネル型TFTの活性層は、チャネル形成領域、前記チャネル形成領域に接して第1不純物領域、前記第1不純物領域に接して第2不純物領域、前記第2不純物領域に接して第3不純物領域を有し、前記ゲート配線は前記チャネル形成領域と重なって形成されており、

前記第1不純物領域の幅は前記ゲート配線の側面に形成された金属膜の厚さによって決定されることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】nチャネル型TFTと、pチャネル型TFTとで形成されるCMOS回路を含む半導体装置において、

活性層上にゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線と、前記ゲート配線の側面および上面を覆う金属膜と、を有し、

前記nチャネル型TFTの活性層は、チャネル形成領域、前記チャネル形成領域に接して第1不純物領域、前記第1不純物領域に接して第2不純物領域、前記第2不純物領域に接して第3不純物領域を有し、前記チャネル形成領域の長さおよび前記ゲート配線の幅および前記第1不純物領域の長さおよび前記金属膜の膜厚は前記ゲート絶縁膜を介して一致しており、

前記第3不純物領域には、前記活性層の結晶化に用いた触媒元素が $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{20}$ atoms/cm²の濃度で存在することを特徴とする半導体装置。

【請求項6】請求項3乃至請求項5のいずれかにおいて、前記第1不純物領域に含まれる不純物濃度は、 $1 \times$

$10^{16} \sim 5 \times 10^{18}$ atoms/cm²であり、前記第2不純物領域に含まれる不純物濃度は、 $2 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{19}$ atoms/cm²であり、前記第3不純物濃度は、 $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}$ atoms/cm²であることを特徴とする半導体装置。

【請求項7】請求項4において、前記触媒元素とはN、i、Ge、Co、Fe、Pd、Sn、Pb、Pt、Cu、Au、またはSiから選ばれた一種または複数種の元素であることを特徴とする半導体装置。

【請求項8】請求項1乃至請求項5のいずれかにおいて、前記金属膜は、Al、Au、Ag、Cu、Cr、Ni、Zn、Sn、またはCoから選ばれた一種または複数種を用いて形成することを特徴とする半導体装置。

【請求項9】請求項1乃至請求項5のいずれかにおいて、前記ゲート配線は、Ta、Ta₂N、W、Mo、Al、CuまたはAuから選ばれた金属を含む材料を用いて形成することを特徴とする半導体装置。

【請求項10】請求項1乃至請求項5のいずれかにおいて、前記ゲート配線は、前記ゲート絶縁膜上に一層または複数層から形成されることを特徴とする半導体装置。

【請求項11】請求項1乃至請求項9のいずれかにおいて、前記半導体装置とは、液晶表示パネルまたはEL表示パネルであることを特徴とする半導体装置。

【請求項12】請求項1乃至請求項9のいずれかにおいて、前記半導体装置とは、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、プロジェクションTV、ゴーグル型ディスプレイ、パーソナルコンピュータまたは携帯情報端末であることを特徴とする半導体装置。

【請求項13】絶縁表面を有する基板上に形成された半導体層を結晶化し、活性層を形成する工程と、前記活性層上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線を形成する工程と、前記ゲート配線をマスクにして不純物を添加し第1不純物領域を形成する工程と、

電解めっき法により前記ゲート配線の側面および上面に金属膜を形成する工程と、

前記金属膜をマスクにして不純物を添加しpチャネル型薄膜トランジスタに第4不純物領域を形成する工程と、前記金属膜をマスクにして不純物を添加し第2の不純物領域を形成する工程と、

前記活性層の選択部分に不純物を添加して第3の不純物領域を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項14】請求項13において、半導体層を結晶化する方法は、熱結晶化、レーザー結晶化、触媒を用いる結晶化から選ばれたいずれか一つまたは複数の方法で行うことを特徴とする半導体装置作製方法。

【請求項15】絶縁表面を有する基板上に形成された半導体層に触媒元素を添加する工程と、

前記半導体層を熱処理して結晶化し、活性層を形成する工程と、
前記活性層上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
前記ゲート絶縁膜上にゲート配線を形成する工程と、
前記ゲート配線をマスクにして不純物を添加し第1の不純物領域を形成する工程と、
電解めっき法により前記ゲート配線の側面および上部に金風膜を形成する工程と、
前記金風膜をマスクにして不純物を添加しpチャネル型薄膜トランジスタに第4の不純物領域を形成する工程と、
前記金風膜をマスクにして不純物を添加し第2の不純物領域を形成する工程と、
前記活性層の選択部分に不純物を添加して第3の不純物領域を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置作製方法。

【請求項16】請求項13乃至請求項15のいずれかにおいて、結晶化に用いる触媒元素は、Ni、Ge、Co、Fe、Pd、Sn、Pb、Pt、Cu、Au、またはSiから選ばれた一種または複数種の元素であることを特徴とする半導体装置作製方法。

【請求項17】請求項13乃至請求項16のいずれかにおいて、前記半導体装置とは、液晶表示パネル、またはEL表示パネルであることを特徴とする半導体装置作製方法。

【請求項18】請求項13乃至請求項16のいずれかにおいて、前記半導体装置とは、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、プロジェクションTV、グループ型ディスプレイ、パーソナルコンピュータまたは携帯情報端末であることを特徴とする半導体装置作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は絶縁表面を有する基板上に薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下、TFTと称する)で構成された回路を有する半導体装置およびその作製方法に関する。例えば、液晶表示装置に代表される電気光学装置および電気光学装置を搭載した電気器具(電子機器という)およびその作製方法に関する。なお、本明細書において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能する装置全般を指し、上記電気光学装置およびその電気光学装置を搭載した電気器具を範疇に含んでいる。

【0002】

【従来の技術】近年、ポリシリコン膜を利用したTFT(以下、結晶質TFTと記す)で回路を構成したアクティブマトリクス型液晶表示装置が注目されている。これは、マトリクス状に配置された複数の画素によって液晶にかかる電界をマトリクス状に制御し、高精細な画像表示装置を実現するものである。

【0003】アクティブマトリクス型液晶表示装置の画

素部はnチャネル型TFTが形成されている場合が多い(以下、画素部に形成されているTFTを画素TFTと記す)。画素TFTは、振幅15〜20V程度のゲート電圧が印加されるので、オン領域とオフ領域の両方の特性を満足する必要があった。一方、画素部を駆動するために設けられる周辺回路はCMOS回路を基本として構成され、主にオン領域の特性が重要であった。しかし、結晶質TFTはオフ電流が上がりやすいという問題点があった。また、結晶質TFTを長期間駆動させると移動度やオン電流の低下、オフ電流の増加といった劣化現象がしばしば観測された。この原因の一つは、ドレイン近傍の高電界が原因で発生するホットキャリア注入現象にあると考えられた。

【0004】LSIの技術分野ではMOSTランジスタのオフ電流を下げ、さらにドレイン近傍の高電界を緩和する方法として、低濃度ドレイン(LDD: Lightly Doped Drain)構造が知られている。この構造は、ドレイン領域とチャネル形成領域の間に低濃度の不純物領域を設けたものであり、この低濃度不純物領域をLDD領域と呼んでいる。

【0005】同様に結晶質TFTでもLDD構造を形成することは知られていた。従来の技術では、ゲート電極をマスクとして、第1の不純物元素の添加工程によりLDD領域となる低濃度不純物領域を形成しておき、その後異方性エッチングの技術を利用してゲート電極の両側にサイドウォールを形成し、ゲート電極とサイドウォールをマスクとして第2の不純物元素の添加工程によりソース領域とドレイン領域となる高濃度不純物領域を形成する方法である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、LDD構造は通常の構造のTFTと比べて、オフ電流を下げるができて、構造的に直列抵抗成分が増えてしまうため、結果としてTFTのオン電流も低下させてしまう欠点があった。また、オン電流の劣化を完全に防ぐことはできなかった。

【0007】本発明はこの様な問題点を克服するための技術を提供するものであり、ゲート電極とLDD領域とをオーバーラップさせた構造のTFTを提供することを目的とする。その目的を達成するために、簡便な方法で、ゲート電極がLDD領域にオーバーラップする構造のTFTを作製する技術を提供することを目的としている。そして、信頼性の高いTFTで回路を形成した半導体装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】本明細書で開示する発明の構成は、ゲート絶縁膜上にゲート配線を有し、前記ゲート配線の側面および上面に膜厚の等しい金風膜を有しているTFTを有することを特徴とする半導体装置である。

【0009】また、他の発明の構成は、ゲート絶縁膜上にゲート配線を有し、前記ゲート配線の側面および上面には電解めっき法によって析出させた金属膜を有しているTFTを有することを特徴とする半導体装置である。

【0010】また、他の発明の構成は、nチャネル型TFTおよびpチャネル型TFTで形成されるCMOS回路を有する半導体装置において、前記nチャネル型TFTおよび前記pチャネル型TFTは、ゲート絶縁膜上にゲート配線を有し、前記ゲート配線は、側面および上面に金属膜を有することを特徴とする半導体装置である。

【0011】また、他の発明の構成は、nチャネル型TFTおよびpチャネル型TFTで形成されるCMOS回路を有する半導体装置において、前記nチャネル型TFTおよび前記pチャネル型TFTのそれぞれの活性層上にゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線と、前記ゲート配線の側面および上面を覆う金属膜と、を有し、前記nチャネル型TFTの活性層は、チャネル形成領域、前記チャネル形成領域に接して第1不純物領域、前記第1不純物領域に接して第2不純物領域、前記第2不純物領域に接して第3不純物領域を有し、前記ゲート配線は前記チャネル形成領域と重なって形成されており、前記第1不純物領域の幅は前記ゲート配線の側面に形成された金属膜の厚さによって決定されることを特徴とする半導体装置である。

【0012】また、他の発明の構成は、nチャネル型TFTと、pチャネル型TFTとで形成されるCMOS回路を含む半導体装置において、活性層上にゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線と、前記ゲート配線の側面および上面を覆う金属膜と、を有し、前記nチャネル型TFTの活性層は、チャネル形成領域、前記チャネル形成領域に接して第1不純物領域、前記第1不純物領域に接して第2不純物領域、前記第2不純物領域に接して第3不純物領域を有し、前記チャネル形成領域の長さおよび前記ゲート配線の幅および前記第1不純物領域の長さおよび前記金属膜の厚さは前記ゲート配線を介して一致しており、前記第3不純物領域には、前記活性層の結晶化に用いた触媒元素が $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{20}$ atoms/cm²の濃度で存在することを特徴とする半導体装置である。

【0013】また、他の発明の構成は、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体層を結晶化し、活性層を形成する工程と、前記活性層上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線を形成する工程と、前記ゲート配線をマスクにして不純物を添加し第1不純物領域を形成する工程と、電解めっき法により前記ゲート配線の側面および上部に金属膜を形成する工程と、前記金属膜をマスクにして不純物を添加しpチャネル型薄膜トランジスタに第4不純物領域を形成する工程と、前記金属膜をマスクにして不純物を添加し第2の不純物領域を形成する工程と、前記活性層の選択部分に不

純物を添加して第3の不純物領域を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の作製方法である。

【0014】また、他の発明の構成は、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体層に触媒元素を添加する工程と、前記半導体層を熱処理して結晶化し、活性層を形成する工程と、前記活性層上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上にゲート配線を形成する工程と、前記ゲート配線をマスクにして不純物を添加し第1不純物領域を形成する工程と、電解めっき法により前記ゲート配線の側面および上部に金属膜を形成する工程と、前記金属膜をマスクにして不純物を添加しpチャネル型薄膜トランジスタに第4不純物領域を形成する工程と、前記金属膜をマスクにして不純物を添加し第2の不純物領域を形成する工程と、前記活性層の選択部分に不純物を添加して第3の不純物領域を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の作製方法である。

【0015】

【発明の実施の形態】
【実施例1】本実施例では、本願発明の半導体装置を作製する方法について、図2、3を用いて説明する。

【0016】まず基板301には、例えばコーニング社の1737ガラス基板に代表されるガラス基板を用いた。そして、基板301のTFTが形成される側の表面に、酸化シリコン膜でなる下地膜302を200nm厚に形成した。下地膜302は窒化シリコン膜を堆積してもよいし、酸化窒化シリコン膜のみであってもよい。下地膜の成膜方法は、プラズマCVD法、熱CVD法またはスパッタ法を用いればよい。

【0017】次に、この下地膜302の上是非晶質シリコン膜をプラズマCVD法により30nm厚に形成した。非晶質シリコン膜の成膜方法は、熱CVD法またはスパッタ法でもよい。非晶質シリコン膜を温水処理した後、結晶化工程を行なうことにより多結晶シリコン膜を形成した。

【0018】この結晶化の工程は、公知のレーザー結晶化技術または熱結晶化の技術を用いればよい。本実施例では、ハルズ発信型のKrFエキシマレーザー光を線状に集光して非晶質シリコン膜に照射し、結晶質シリコン膜とした。

【0019】本実施例では、初期膜を非晶質シリコン膜として用いたが、初期膜として微結晶シリコン膜を用いても構わないし、直接結晶性シリコン膜を成膜してもよい。

【0020】こうして形成された結晶質シリコン膜をパターンニングして、島状のシリコン層からなる活性層303、304を形成した。

【0021】なお、結晶質シリコン膜を形成した後、エキシマレーザー光を照射して結晶性を高めてもよい。また、活性層303、304を形成した後に行なっても構わない。

【0022】次に、酸化シリコン膜でなるゲート絶縁膜305を膜厚100nmで、活性層303、304を覆って形成した。続いて、ゲート絶縁膜305の上にタンタルと窒化タンタルの積層構造でなるゲート配線306、307を形成した。ゲート配線306は他の金属を用いることもできるが、後の工程を考慮するとシリコンとのエッチング選択比の高い材料が望ましい。(図2(A))

【0023】後のpチャネル型薄膜トランジスタ(以下、PTFTという)となる領域全体を覆うようにして、ゲート絶縁膜305上にレジストマスク308を形成した。

【0024】この状態で1回目のリンを添加する工程を行なった。ここではゲート絶縁膜を通して不純物を添加するため、加速電圧は80KeVと設定した。こうして形成された第1不純物領域309はリン濃度が、 $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^2$ (好ましくは $3 \times 10^{17} \sim 3 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^2$)となるようにドーズ量を調整した。この時のリン濃度を(n')で表すことにする。また、第1不純物領域はゲート配線306をマスクとして自己整合的に形成した。第1不純物領域309は、LDD領域として機能することになる。(図2(B))

【0025】次に、本実施例では、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 電解液を用いた公知の電解めっき法により、導電層の側面および上面に銅(Cu)を0.1~1 μm (好ましくは0.2~0.5 μm)析出させた。(図2(C))

【0026】電解めっき法は図1に示すように、電解質溶液103に2個の電極を浸し、外部から電流を通すると両電極間で電気化学的変化が生じることによって行われる。したがって、液中の+イオンが放電するカソード電極101(金属が析出する側の電極)を前記ゲート配線とし、-イオンが放電するか、または金属が溶解して金属イオンとなるアノード電極102をCu電極で形成し、コンタクトパッドを介して電流が流れるようにすれば、前記ゲート配線の側面および上部にCuからなる金属膜を析出させることができる。

【0027】電解めっき法は、カソード電極で金属イオンが還元されて析出する現象であり、電極反応の量は通電量に比例するので、析出する金属膜の膜厚を容易に調整することができ、ゲート電極の側面および上面に析出する金属膜の膜厚を等しくすることも容易である。

【0028】金属膜311、312を形成した後、NTFTの全体を覆うようにしてレジストマスク313を形成した。

【0029】この状態で、ボロンを添加する工程を行なった。ここでは加速電圧を10KeVとし、第4不純物領域314を形成した。ボロンが $3 \times 10^{20} \sim 3 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^2$ (好ましくは $5 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^2$)の濃度で含まれるようにドーズ量を調節した。この時のボロン濃度を(p'')と表すことにする。また、

PTFTのチャネル形成領域315が画定した。(図2(D))

【0030】次に、PTFTの全体を覆うようにしてレジストマスク316を形成した。

【0031】この状態で、2回目のリンを添加する工程を行なった。この場合も加圧電圧を80KeVとした。2回目の不純物添加(リンドーパ)工程では、金属層311をドーパマスクとして、自己整合的に第2不純物領域317を形成し、リンが $2 \times 10^{18} \sim 5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^2$ (好ましくは $5 \times 10^{17} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^2$)の濃度で含まれるようにドーズ量を調整した。この時のリン濃度を(n)で表すことにする。第2不純物領域317はLDD領域として機能することになる。(図2(E))

【0032】次に後のnチャネル型TFT(以下、NTFTと記す。)となる領域の一部を覆うレジストマスク318と、PTFTの全体を覆うレジストマスク319を形成した。

【0033】この状態で、3回目のリンを添加する工程を行ない、第3不純物領域320を形成した。ここでは加速電圧を10KeVとし、第3不純物領域にはリンが $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^2$ (好ましくは $2 \times 10^{20} \sim 5 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^2$)の濃度で含まれるようにドーズ量を調整した。この時のリンの濃度を(n')で表すことにする。第3不純物領域320はソース領域またはドレイン領域として機能する。(図3(A))

【0034】レジストマスク318、319を除去し、後のNTFTとなる領域および後のPTFTとなる領域全部を覆う保護膜321を形成した。この時保護膜として設けられた窒化シリコン膜は、ゲート配線(タンタル膜)306、307および金属膜(銅膜)311、312が酸化されるのを防ぐ。保護膜としては、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜を用いることができ、その膜厚範囲は、1~30nm、好ましくは5~20nmとした。(図3(B))

【0035】PTFTは、もともと信頼性が高いので問題なくあってLDD領域等を設けないほうがオン電流を稼ぐことができるので都合がよい場合もあるため、本実施例ではPTFTに対してLDD領域もオフセット領域も形成していない。

【0036】こうして最終的には、NTFTの活性層にはチャネル形成領域、第1の不純物領域、第2の不純物領域および第3の不純物領域が形成され、 $L_{\text{off}}=0.5 \sim 3.0 \mu\text{m}$ (1.0~1.5 μm)、 $L_{\text{off}}=0.5 \sim 3.0 \mu\text{m}$ (1.0~2.0 μm)の幅になった。PTFTの活性層にはチャネル形成領域および第4の不純物領域のみが形成された。

【0037】電解めっき法によって、ゲート配線の側面および上面に金属膜を形成し、この金属膜をマスクとして不純物を添加することで、自己整合的にLDD領域を

形成することができた。また、この金属膜の膜厚を変えれば、LDD領域の長さ(幅)を変えることができる。

【0038】[実施例2]実施例1で作製したTFT(図3(B))をドライバー回路として、また、アクティブマトリクス基板の画素TFTに実施例1で示された方法で作製されたNTFT(ただし、マルチゲート構造である)を採用したアクティブマトリクス型液晶表示装置の画素部におけるTFTに接続される保持容量の構成について図4を用いて説明する。

【0039】第1層間絶縁膜322を1 μ mの厚さに形成した。本実施例ではアクリル樹脂膜を採用した。第1層間絶縁膜322を形成した後、金属材料であるソース配線323、324、325およびドレイン配線326、327を形成した。本実施例ではタンを含むアルミニウム膜をタンニングで挟み込んだ構造の三層配線を用いた。

【0040】こうしてソース配線およびドレイン配線を形成したら、第1層間絶縁膜として50nm厚の窒化シリコン膜328を形成した。その上に第2層間絶縁膜329を形成した。この第2層間絶縁膜329としては50nm厚の酸化シリコン膜上に有機樹脂膜を積層した構造を採用した。有機樹脂膜としては、ポリイミド、アクリル、ポリイミドアミド等を使用することができる。有機性樹脂膜を用いることの利点は、成膜方法が簡単である点や、比誘電率が低いので、寄生容量を低減できる点、平坦性に優れる点などが上げられる。なお、上述した以外の有機性樹脂膜を用いることもできる。ここでは、基板に塗布後、熱重合するタイプのポリイミドを用い、300℃で焼成して形成した。

【0041】次に、第2層間絶縁膜329上の画素領域の一部に、遮光層330を形成した。遮光層330はアルミニウム、タン、タンタル等の金属材料、これらの金属を主成分とする膜または有機樹脂膜で形成すればよい。ここでは、タンをスパッタ法で形成した。

【0042】遮光膜を形成したら、第3の層間絶縁膜331を形成する。この第3層間絶縁膜331は、第2層間絶縁膜329と同様に、有機樹脂膜を用いて形成するとい、そして、第2層間絶縁膜329と第3層間絶縁膜331とにドレイン電極327に連するコンタクトホールを形成し、画素電極332を形成した。画素電極332は、透過型液晶表示装置とする場合には透明導電膜を用い、反射型の液晶表示装置とする場合には金属膜を用いなければならない。ここでは、透過型の液晶表示装置とするために、酸化インジウム・スズ(ITO)膜を100nmの厚さにスパッタ法で形成し、画素電極332を形成した。

【0043】図4(A)の状態が形成されたら、配向膜333を形成する。通常、液晶表示素子の配向膜にはポリイミド樹脂が多く用いられている。対向側の基板336には、透明導電膜(画素電極)335と、配向膜33

4とを形成した。配向膜は形成された後、ラビング処理を施して液晶分子がある一定のプレチルト角を持って平行配向するようにした。

【0044】上記の工程を経て、画素マトリクス回路と、CMOS回路が形成された基板と対向基板とを公知のセル組み工程によってシール材やスペーサ(ともに図示せず)などを介して貼りあわせる。その後、両基板の間に液晶材料337を注入し、封止材(図示せず)によって完全に封止した。よって、図4(B)に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成した。

【0045】本実施例によって、ゲート配線の側面および上面に金属膜を形成し、完成したCMOS回路は、NTFTが優れた信頼性を有するため、回路全体として信頼性が大幅に向上した。また、本実施例のような構造とすると、NTFTとPTFTとの特性バランスがよくなるため、動作不良を起こしにくくなることがわかった。

【0046】[実施例3]実施例1の作製方法において、図2(A)に示す工程を終了した後、PTFTの全体および画素部の全体を覆うレジストマスク403、404を形成し、1回目のリンを添加する工程を行った。その結果、駆動回路部のNTFTにおいて、ゲート配線306をマスクとして、自己整合的に第1不純物領域309、チャネル形成領域310が形成された。(図5(A))

【0047】次に、電解めっき法により、ゲート配線311、312、401、402の側面および上部に金属膜311、312、406、407を形成した。(図5(B))

【0048】このあとの工程は、実施例2に従って行ない、図7(B)に示すようなアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成した。

【0049】[実施例4]実施例1ではゲート配線306、307としてタンタルと窒化タンタルの積層、金属膜311、312として銅を用いたが、本実施例では、ゲート配線の材料として低抵抗金属、例えば、Al、W、Mo、Cu、Au、Nbといった金属を主成分とする材料、また、金属膜として高融点金属の材料として、例えば、Ta、Mo、Wといった金属を主成分とする材料を用いて形成した。本実施例のように、高融点金属をゲート配線の側面および上部に形成すれば、高融点金属が、ゲート配線を保護するため、高い温度で熱活性化が行なえるという長所がある。本実施例は、実施例1〜3と組み合わせで用いることができる。

【0050】[実施例5]実施例1ではゲート配線306、307としてタンタルと窒化タンタルの積層、金属膜311、312として銅を用いたが、本実施例では、ゲート配線、金属膜の材料として高融点金属、例えば、Ta、W、Mo、Cr、Ni、Znなどを主成分とする材料を用いて形成した。ゲート配線および金属膜が、どちらも高融点金属であるため高い温度で熱活性化でき、

さらに2つの金属を同じ物にすることで金属どうしが剥がれにくくすることができ、本実施例は、実施例1〜3と組み合わせ用いることができる。

【0051】[実施例6]本実施例では、実施例1において半導体層として用いる結晶質半導体膜を、触媒元素を用いた熱結晶化法により形成する例を示す。触媒元素を用いる場合、特開平7-130652号公報、特開平8-78329号公報で開示された技術を用いることが望ましい。

【0052】ここで、特開平7-130652号公報に開示されている技術を本発明に適用する場合の例を図8に示す。まず基板601に酸化シリコン膜602を設け、その上に非晶質シリコン膜603を形成した。さらに、重量換算で10ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液を塗布してニッケル含有層604を形成した。(図8(A))

【0053】次に、500℃、1時間の脱水素工程の後、500〜650℃で4〜12時間(本実施例では550℃、14時間)の熱処理を行い、結晶質シリコン膜605を形成した。こうして得られた結晶質シリコン膜605は非常に優れた結晶性を有した。(図8(B))

【0054】また、特開平8-78329号公報で開示された技術は、触媒元素を選択的に添加することによって、非晶質半導体膜の選択的な結晶化を可能としたものである。同技術を本発明に適用した場合について、図9で説明する。

【0055】まず、ガラス基板701に酸化珪素膜702を設け、その上に非晶質シリコン膜703、酸化シリコン膜704を連続的に形成した。

【0056】次に酸化シリコン膜704をパターンニングして、選択的に開孔部705を形成し、その後、重量換算で10ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液を塗布した。これにより、ニッケル含有層706が形成され、ニッケル含有層706は開孔部705から露出している非晶質シリコン膜702のみに接触した。(図9(A))

【0057】次に、500〜650℃で4〜24時間(本実施例では580℃、14時間)の熱処理を行い、結晶質シリコン膜707を形成した。この結晶化の過程では、ニッケルが接した非晶質シリコン膜の部分で最初に結晶化し、そこから横方向へと結晶化が進行する。こうして形成された結晶質シリコン膜707は棒状または針状の結晶が集まって成り、その各々の結晶は巨視的にはある特定の方向性をもって成長しているため、結晶性が揃っているという利点がある。

【0058】尚、上記2つの技術において使用可能な触媒元素は、ニッケル(Ni)の以外にも、ゲルマニウム(Ge)、鉄(Fe)、パラジウム(Pd)、スズ(Sn)、鉛(Pb)、コバルト(Co)、白金(Pt)、銅(Cu)、金(Au)、といった元素を用いても良

い。

【0059】以上のような技術を用いて結晶質半導体膜(結晶質シリコン膜や結晶質シリコンゲルマニウム膜などを含む)を形成し、パターンニングを行えば、TFTの半導体層を形成することができる。結晶質半導体膜から作製されたTFTは優れた特性が得られるがそのため高い信頼性を要求されていた。しかしながら、本発明のTFT構造を採用することで、本実施例の技術を最大限に生かしたTFTを作製することが可能となった。本実施例は、実施例1〜5のいずれかと組み合わせてもいいことができる。

【0060】[実施例7]本実施例は、実施例1で用いられる半導体層を形成する方法として、実施例6のように非晶質半導体膜を初期膜として前記触媒元素を用いて結晶質半導体膜を形成した後で、その触媒元素を結晶質半導体膜から除去する工程を行った例を示す。本実施例ではその方法として、特開平10-135468号公報または特開平10-135469号公報に記載された技術を用いた。

【0061】同公報に記載された技術は、非晶質半導体膜の結晶化に用いた触媒元素を結晶化後にリンのゲタリング作用を用いて除去する技術である。同技術を用いることで、結晶質半導体膜中の触媒元素の濃度を 1×10^{17} atoms/cm²以下、好ましくは 1×10^{16} atoms/cm²にまで低減することができる。

【0062】本実施例の構成について図20を用いて説明する。ここではコーニング社の1737基板に代表される無アルカリガラス基板を用いた。図20(A)では、実施例6で示した結晶化の技術を用いて、下地膜802、結晶質シリコン膜803が形成された状態を示している。そして、結晶質シリコン膜803の表面にマスク用の酸化珪素膜804が150nmの厚さに形成され、パターンニングにより開孔部が設けられ、結晶質シリコン膜を露出させた領域を設けてある。そして、リンを添加する工程を実施して、結晶質シリコン膜にリンが添加された領域805が設けられた。

【0063】この状態で、窒素雰囲気中で550〜800℃、5〜24時間(本実施例では600℃、12時間)の熱処理を行うと、結晶質シリコン膜にリンが添加された領域805がゲタリングサイトとして働き、結晶質シリコン膜803に残存していた触媒元素はリンが添加された領域805に移動させることができる。

【0064】そして、マスク用の酸化シリコン膜804と、リンが添加された領域805とをエッチングして除去することにより、結晶化の工程で使用した触媒元素の濃度を 1×10^{17} atoms/cm²以下にまで低減された結晶質シリコン膜を得ることができた。この結晶質シリコン膜はそのまま実施例1で示した本発明のTFTの活性層として使用することができた。本実施例は、実施例1〜5のいずれかと組み合わせ用いることができる。

【0065】【実施例8】本実施例では、実施例1で示した本願発明のTFTを作製する工程において、半導体層とゲート絶縁膜を形成する他の実施形態を示す。

【0066】ここでは、少なくとも700~1100℃程度の耐熱性を有する基板が必要であり、石英基板901が用いられた。そして実施例6及び実施例7で示した技術を用い、結晶質半導体膜が形成され、島状にパターンニングして活性層902、903を形成した。そして、活性層902、903を覆って、ゲート絶縁膜904を、酸化珪素を主成分とする膜で形成した。本実施例では、プラズマCVD法で窒化酸化シリコン膜を70nmの厚さで形成した。(図21(A))

【0067】そして、ハロゲン(代表的には塩素)と酸素を含む雰囲気中で熱処理を行った。本実施例では、950℃、30分とした。尚、処理温度は700~1100℃の範囲で選択すれば良く、処理時間も10分から8時間の間で選択すれば良い。(図21(B))

【0068】その結果、本実施例の条件では、活性層902、903とゲート絶縁膜904との界面で熱酸化膜が形成され、ゲート絶縁膜907が形成された。

【0069】以上の工程で作製されたゲート絶縁膜907は、絶縁耐圧が高く、活性層905、906とゲート絶縁膜907の界面は非常に良好なものであった。本願発明のTFTの構成を得るためには、以降の工程は実施例1に従えば良い。

【0070】勿論、本実施例に実施例6や実施例7を組み合わせることが実施者が適宜決定すれば良い。

【0071】【実施例9】上述の本発明の液晶表示装置にはネマチック液晶以外にも様々な液晶を用いることが可能である。例えば、1998, SID, "Characteristics and Driving Scheme of Polymer-Stabilized Monostable FLC Exhibiting Fast Response Time and High Contrast Ratio with Gray-Scale Capability" by H. Furue et al. 1.や、1997, SID DIGEST, 841, "A Full-Color Thresholdless Antiferroelectric LCDE Exhibiting Wide Viewing Angle with Fast Response Time" by T. Yoshida et al. 1.や、1996, J. Mater. Chem. 6(4), 671-673, "Thresholdless antiferroelectricity in liquid crystals and its application to displays" by S. Inui et al. や、米国特許第5594569号に開示された液晶を用いることが可能である。

【0072】等方相-コレステリック相-カイラルスメティック相転移系列を示す強誘電性液晶(FLC)を用い、DC電圧を印加しながらコレステリック相-カイラルスメティック相転移をさせ、かつコーンエッジをばらばら方向に一致させた単安定FLCの電気光学特性を図10に示す。図10に示すような強誘電性液晶による表示モードは「H a i f-V字スイッチングモード」と呼ばれている。図10に示すグラフの縦軸は透過率(任意単位)、横軸は印加電圧である。「H a i

f-V字スイッチングモード」については、寺田らの「H a i f-V字スイッチングモードFLCD」、第46回応用物理学会関係連合講演会講演予稿集、1999年3月、第1316頁、および吉原らの「強誘電性液晶による時分割フルカラーLCD」、液晶第3巻第3号第190頁に詳しい。

【0073】図10に示されるように、このような強誘電性混合液晶を用いると、低電圧駆動かつ階調表示が可能となることがわかる。本発明の液晶表示装置には、このような電気光学特性を示す強誘電性液晶も用いることができる。

【0074】また、ある温度域において反強誘電相を示す液晶を反強誘電性液晶(AFLC)という。反強誘電性液晶を有する混合液晶には、電場に対して透過率が連続的に変化する電気光学応答特性を示す、無しき値反強誘電性混合液晶と呼ばれるものがある。この無しき値反強誘電性混合液晶は、いわゆるV字型の電気光学応答特性を示すものがあり、その駆動電圧が約2.5V程度(セル厚約1μm~2μm)のものも見出されている。

【0075】また、一般に、無しき値反強誘電性混合液晶は自発分極が大きく、液晶自体の誘電率が高い。このため、無しき値反強誘電性混合液晶を液晶表示装置に用いる場合には、画素に比較的大きな保持容量が必要となってくる。よって、自発分極が小さな無しき値反強誘電性混合液晶を用いるのが好ましい。

【0076】なお、このような無しき値反強誘電性混合液晶を本発明の液晶表示装置に用いることによって低電圧駆動が実現されるので、低消費電力化が実現される。

【0077】【実施例10】本願発明を実施して形成されたCMOS回路や画素部は様々な電気光学装置(アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型LEDディスプレイ)に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電気器具全てに本発明を実施できる。

【0078】その様な電気器具としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター(リア型またはフロント型)、ヘッドマウントディスプレイ(ゴーグル型ディスプレイ)、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等)などが挙げられる。それらの一例を図11、図12及び図13に示す。

【0079】図11(A)はパーソナルコンピュータであり、本体2001、画像入力部2002、表示部2003、キーボード2004等を含む。本発明を画像入力部2002、表示部2003やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0080】図11(B)はビデオカメラであり、本体2101、表示部2102、音声入力部2103、操作

スイッチ2104、バッテリー2105、受像部2106等を含む。本発明を表示部2102やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0081】図11(C)はモバイルコンピュータ(モバイルコンピュータ)であり、本体2201、カメラ部2202、受像部2203、操作スイッチ2204、表示部2205等を含む。本発明は表示部2205やその他の信号制御回路に適用できる。

【0082】図11(D)はゴグル型ディスプレイであり、本体2301、表示部2302、アーム部2303等を含む。本発明は表示部2302やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0083】図11(E)はプログラムを記録した記録媒体(以下、記録媒体と呼ぶ)を用いるプレーヤーであり、本体2401、表示部2402、スピーカ部2403、記録媒体2404、操作スイッチ2405等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてDVD(Digital Versatile Disc)、CD等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部2402やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0084】図11(F)はデジタルカメラであり、本体2501、表示部2502、接眼部2503、操作スイッチ2504、受像部(図示しない)等を含む。本発明は表示部2502やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0085】図12(A)はフロント型プロジェクターであり、投射装置2601、スクリーン2602等を含む。本発明は投射装置2601の一部を構成する液晶表示装置2808やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0086】図12(B)はリア型プロジェクターであり、本体2701、投射装置2702、ミラー2703、スクリーン2704等を含む。本発明は投射装置2702の一部を構成する液晶表示装置2808やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0087】なお、図12(C)は、図12(A)及び図12(B)中における投射装置2601、2702の構造の一例を示した図である。投射装置2601、2702は、光源光学系2801、ミラー2802、2804〜2806、ダイクロックミラー2803、プリズム2807、液晶表示装置2808、位相差板2809、投射光学系2810で構成される。投射光学系2810は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図12(C)中において矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するためのフィルム、IRフィルム等の光学系を設けてよい。

【0088】また、図12(D)は、図12(C)中に

おける光源光学系2801の構造の一例を示した図である。本実施例では、光源光学系2801は、リフレクター2811、光源2812、レンズアレイ2813、2814、偏光変換素子2815、集光レンズ2816で構成される。なお、図12(D)に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するフィルム、IRフィルム等の光学系を設けてもよい。

【0089】ただし、図12に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場合を示しており、反射型の電気光学装置及びEL表示装置での適用例は図示していない。

【0090】図13(A)は携帯電話であり、本体2901、音声出力部2902、音声入力部2903、表示部2904、操作スイッチ2905、アンテナ2906等を含む。本発明は音声出力部2902、音声入力部2903、表示部2904やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0091】図13(B)は携帯書籍(電子書籍)であり、本体3001、表示部3002、3003、記憶媒体3004、操作スイッチ3005、アンテナ3006等を含む。本発明は表示部3002、3003やその他の信号回路に適用することができる。

【0092】図13(C)はディスプレイであり、本体3101、支持台3102、表示部3103等を含む。本発明は表示部3103に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において有利であり、対角10インチ以上(特に30インチ以上)のディスプレイには有利である。

【0093】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例1〜8のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

【0094】【実施例11】本実施例では、本発明を用いてEL(エレクトロルミネッセンス)表示装置を作製した例について説明する。

【0095】図14(A)は本発明を用いたEL表示装置の上面図である。図14(A)において、4010は基板、4011は画素部、4012はソース側駆動回路、4013はゲート側駆動回路であり、それぞれの駆動回路は配線4014〜4016を経てFPC4017に至り、外部機器へと接続される。

【0096】このとき、少なくとも画素部、好ましくは駆動回路及び画素部を囲むようにしてカバー材6000、シーリング材(ハウジング材ともいう)7000、密封材(第2のシーリング材)7001が設けられている。

【0097】また、図14(B)は本実施例のEL表示

装置の断面構造であり、基板4010、下地膜4021の上に駆動回路用TFT(但し、ここではnチャネル型TFTとpチャネル型TFTを組み合わせたCMOS回路を図示している。)4022及び画素部用TFT4023(但し、ここではEL素子への電流を制御するTFTだけ図示している。)が形成されている。これらのTFTは本発明により作製されたTFTを用いれば良い。

【0098】本発明は、駆動回路用TFT4022、画素部用TFT4023に際して用いることができる。

【0099】本発明を用いて駆動回路用TFT4022、画素部用TFT4023が完成したら、樹脂材料でなる層間絶縁膜(平坦化膜)4026の上に画素部用TFT4023のドレインと電気的に接続する透明導電膜でなる画素電極4027を形成する。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物(ITOと呼ばれる)または酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができる。そして、画素電極4027を形成したら、絶縁膜4028を形成し、画素電極4027上に開口部を形成する。

【0100】次に、EL層4029を形成する。EL層4029は公知のEL材料(正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層または電子注入層)を自由に組み合わせ、積層構造または単層構造とすれば良い。どのような構造とするかは公知の技術を用いれば良い。また、EL材料には低分子系材料と高分子系(ポリマ系)材料がある。低分子系材料を用いる場合は蒸着法を用いるが、高分子系材料を用いる場合には、スピコート法、印刷法またはインクジェット法等の簡易な方法を用いることが可能である。

【0101】本実施例では、シャドーマスクを用いて蒸着法によりEL層を形成する。シャドーマスクを用いて画素毎に波長の異なる発光が可能な発光層(赤色発光層、緑色発光層及び青色発光層)を形成することで、カラー表示が可能となる。その他にも、色変換層(CCM)とカラーフィルターを組み合わせた方式、白色発光層とカラーフィルターを組み合わせた方式があるがいずれの方法を用いても良い。勿論、単色発光のEL表示装置とすることもできる。

【0102】EL層4029を形成したら、その上に陰極4030を形成する。陰極4030とEL層4029の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが望ましい。従って、真空中でEL層4029と陰極4030を連続成膜するか、EL層4029を不活性雰囲気中で形成し、大気解放しないで陰極4030を形成するといった工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンバ方式(クラスターツール方式)の成膜装置を用いることで上述のような成膜を可能とする。

【0103】なお、本実施例では陰極4030として、LiF(フッ化リチウム)膜とAl(アルミニウム)膜の積層構造を用いる。具体的にはEL層4029上に蒸

着法で1nm厚のLiF(フッ化リチウム)膜を形成し、その上に300nm厚のアルミニウム膜を形成する。勿論、公知の陰極材料であるMgAg電極を用いても良い。そして陰極4030は4031で示される領域において配線4016に接続される。配線4016は陰極4030に所定の電圧を与えるための電源供給線であり、導電性ペースト材料4032を介してFPC4017に接続される。

【0104】4031に示される領域において陰極4030と配線4016とを電気的に接続するために、層間絶縁膜4026及び絶縁膜4028にコンタクトホールを形成する必要がある。これらは層間絶縁膜4026のエッチング時(画素電極用コンタクトホールの形成時)や絶縁膜4028のエッチング時(EL層形成前の開口部の形成時)に形成しておけば良い。また、絶縁膜4028をエッチングする際に、層間絶縁膜4026まで一括でエッチングしても良い。この場合、層間絶縁膜4026と絶縁膜4028が同じ樹脂材料であれば、コンタクトホールの形状を良好なものとすることができる。

【0105】このようにして形成されたEL素子の表面を覆って、パッシベーション膜6003、充填材6004、カバー材6000が形成される。

【0106】さらに、EL素子部を囲むようにして、カバー材6000と基板4010の内側にシーリング材が設けられ、さらにシーリング材7000の外側には密封材(第2のシーリング材)7001が形成される。

【0107】このとき、この充填材6004は、カバー材6000を接着するための接着剤としても機能する。充填材6004としては、PVC(ポリビニルクロライド)、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB(ポリビニルブチラル)またはEVA(エチレンビニルアセテート)を用いることができる。この充填材6004の内部に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好ましい。

【0108】また、充填材6004の中にスペーサーを含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなどからなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもたせてもよい。

【0109】スペーサーを設けた場合、パッシベーション膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。また、パッシベーション膜とは別に、スペーサー圧を緩和する樹脂膜などを設けてもよい。

【0110】また、カバー材6000としては、ガラス板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP(Fiber glass-Reinforced Plastic)板、PVF(ポリビニルフルオリド)フィルム、マイラーフィルム、ポリエチレンフィルムまたはアクリルフィルムを用いることができる。なお、充填材6004としてPVBやEVAを用いる場合、数十μmのアルミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで

挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

【0111】但し、EL素子からの発光方向（光の放射方向）によっては、カバー材6000が透光性を有する必要がある。

【0112】また、配線4016はシーリング材7000および密封材7001と基板4010との隙間を通してFPC4017に電気的に接続される。なお、ここでは配線4016について説明したが、他の配線4014、4015も同様にしてシーリング材7000および密封材7001の下を通してFPC4017に電気的に接続される。

【0113】【実施例12】本実施例では、本発明を用いて実施例11とは異なる形態のEL表示装置を作製した例について、図15(A)、図15(B)を用いて説明する。図14(A)、14(B)と同じ番号のものは同じ部分を示しているため説明は省略する。

【0114】図15(A)は本実施例のEL表示装置の上面図であり、図15(B)をA-Aで切断した断面図を図15(B)に示す。

【0115】実施例10に従って、EL素子の表面を覆ってパッシベーション膜6003を形成する。

【0116】さらに、EL素子を覆うようにして充填材6004を設ける。この充填材6004は、カバー材6000を接着するための接着剤としても機能する。充填材6004としては、PVC（ポリビニルクロライド）、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、PVB（ポリビニルブチラル）またはEVA（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。この充填材6004の内部に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好ましい。

【0117】また、充填材6004の中にスペーサーを含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなどからなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもちせてもよい。

【0118】スペーサーを設けた場合、パッシベーション膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。また、パッシベーション膜とは別に、スペーサー圧を緩和する樹脂層などを設けてもよい。

【0119】また、カバー材6000としては、ガラス板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP（Fiberglass-Reinforced Plastic）板、PVF（ポリビニルフルオライド）フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリルフィルムを用いることができる。なお、充填材6004としてPVBやEVAを用いる場合、数十μmのアルミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

【0120】但し、EL素子からの発光方向（光の放射方向）によっては、カバー材6000が透光性を有する必要がある。

【0121】次に、充填材6004を用いてカバー材6000を接着した後、充填材6004の側面（露出面）を覆うようにフレーム材6001を取り付ける。フレーム材6001はシーリング材（接着剤として機能する）6002によって接着される。このとき、シーリング材6002としては、光硬化性樹脂を用いるのが好ましいが、EL層の耐熱性が許せば熱硬化性樹脂を用いてもよい。なお、シーリング材6002はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、シーリング材6002の内部に乾燥剤を添加してあってもよい。

【0122】また、配線4016はシーリング材6002と基板4010との隙間を通してFPC4017に電気的に接続される。なお、ここでは配線4016について説明したが、他の配線4014、4015も同様にしてシーリング材6002の下を通してFPC4017に電気的に接続される。

【0123】【実施例13】ここでEL表示パネルにおける画素部のさらに詳細な断面構造を図16に、上面構造を図17(A)に、回路図を図17(B)に示す。図16、図17(A)及び図17(B)では共通の符号を用いるので互いに参照すればよい。

【0124】図16において、基板3501上に設けられたスイッチング用TFT3502は本願発明のNTFTを用いて形成される（実施例1〜7参照）。本実施例ではダブルゲート構造としているが、構造及び作製プロセスに大きな違いはないので説明は省略する。但し、ダブルゲート構造とすることで実質的に二つのTFTが直列された構造となり、オフ電流値を低減することができるという利点がある。なお、本実施例ではダブルゲート構造としているが、シングルゲート構造でも構わないし、トリプルゲート構造やそれ以上のゲート本数を持つマルチゲート構造でも構わない。

【0125】また、電流制御用TFT3503は本発明のNTFTを用いて形成される。このとき、スイッチング用TFT3502のドレイン配線35は配線36によって電流制御用TFTのゲート電極37に電気的に接続されている。また、38で示される配線は、スイッチング用TFT3502のゲート電極39a、39bを電気的に接続するゲート配線である。

【0126】このとき、電流制御用TFT3503が本発明の構造であることは非常に重要な意味を持つ。電流制御用TFTはEL素子を流れる電流量を制御するための素子であるため、多くの電流が流れ、熱による劣化やホットキャリアによる劣化の危険性が高い素子でもある。そのため、電流制御用TFTに、ゲート絶縁膜を介してゲート電極に重なるようにLDD領域を設ける本発明の構造は極めて有効である。

【0127】また、本実施例では電流制御用TFT3503をシングルゲート構造で図示しているが、複数のT

FTを直列につなげたマルチゲート構造としても良い。さらに、複数のTFTを並列につなげて実質的にチャネル形成領域を複数に分割し、熱の放射を高い効率で行えるようにした構造としても良い。このような構造は熱による劣化対策として有効である。

【0128】また、図17(A)に示すように、電流制御用TFT3503のゲート電極37となる配線は3504で示される領域で、電流制御用TFT3503のドレイン配線40と絶縁膜を介して重なる。このとき、3504で示される領域ではコンデンサが形成される。このコンデンサ3504は電流制御用TFT3503のゲートにかかる電圧を保持するためのコンデンサとして機能する。なお、ドレイン配線40は電流供給線(電源線)3506に接続され、常に一定の電圧が加えられている。

【0129】スイッチング用TFT3502及び電流制御用TFT3503の上には第1バッシェンション膜41が設けられ、その上に樹脂絶縁膜で平坦化膜42が形成される。平坦化膜42を用いてTFTによる段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成されるE層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合がある。従って、E層をできるだけ平坦面に形成するように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ましい。

【0130】また、43は反射性の高い導電膜でなる画素電極(E層素子の陰極)であり、電流制御用TFT3503のドレインに電気的に接続される。画素電極43としてはアルミニウム合金膜、銅合金膜または銀合金膜など低抵抗な導電膜またはそれらの積層膜を用いることが好ましい。勿論、他の導電膜との積層構造としても良い。

【0131】また、絶縁膜(好ましくは樹脂)で形成されたバンク44a、44bにより形成された溝(画素に相当する)の中に発光層45が形成される。なお、ここでは一画素しか図示していないが、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色に対応した発光層を作り分けても良い。発光層とする有機E層材料としてはπ共役ポリマー系材料を用いる。代表的なポリマー系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン(PPV)系、ポリビニルカルバゾール(PVK)系、ポリフルオレン系などが挙げられる。

【0132】なお、PPV系有機E層材料としては様々な型のものがあるが、例えば「H. Shenk, H. Becker, O. Geisen, E. Kluge, W. Kreyder, and H. Spreitzer, "Polymers for Light Emitting Diodes", Euro Display, Proceeding s, 1999, p. 33-37」や特開平10-092576号公報に記載されたような材料を用いれば良い。

【0133】具体的な発光層としては、赤色に発光する発光層にはシアンポリフェニレンビニレン、緑色に発光する発光層にはポリフェニレンビニレン、青色に発光する

発光層にはポリフェニレンビニレン若しくはポリアルキルフェニレンを用いれば良い。膜厚は30~150nm(好ましくは40~100nm)とすれば良い。

【0134】但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機E層材料の一例であって、これに限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせることでE層(発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層)を形成すれば良い。

【0135】例えば、本実施例ではポリマー系材料を発光層として用いる例を示したが、低分子系有機E層材料を用いても良い。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これらの有機E層材料や無機材料は公知の材料を用いることができる。

【0136】本実施例では発光層45の上にPEDOT(ポリチオフェン)またはPANI(ポリアニリン)でなる正孔注入層46を設けた積層構造のE層としている。そして、正孔注入層46の上には透明導電膜でなる陽極47が設けられる。本実施例の場合、発光層45で生成された光は上面側に向かって(TFTの上方に向かって)放射されるため、陽極は透光性でなければならぬ。透明導電膜としては酸化インジウムと酸化スズとの化合物や酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができるが、耐熱性の低い発光層や正孔注入層を形成した後で形成するため、可能な限り低温で成膜できるものが好ましい。

【0137】陽極47で形成された時点でE層素子3505が完成する。なお、ここではE層素子3505は、画素電極(陰極)43、発光層45、正孔注入層46及び陽極47で形成されたコンデンサを指す。図17(A)に示すように画素電極43は画素の面積にほぼ一致するため、画素全体がE層素子として機能する。従って、発光の利用効率が高くなり、明るい画像表示が可能となる。

【0138】ところで、本実施例では、陽極47の上さらに第2バッシェンション膜48を設けている。第2バッシェンション膜48としては窒化珪素膜または窒化炭素膜が好ましい。この目的は、外部とE層素子とを遮断することであり、有機E層材料の酸化による劣化を防ぐ意味と、有機E層材料からの脱ガスを抑える意味との両方を併せ持つ。これによりE層表示装置の信頼性が高められる。

【0139】以上のように本発明のE層表示パネルは図16のような構造の画素からなる画素部を有し、オフ電流値の十分に低いスイッチング用TFTと、ホットキャリア注入に強い電流制御用TFTとを有する。従って、高い信頼性を有し、且つ、良好な画像表示が可能なE層表示パネルが得られる。

【0140】なお、本実施例の構成は、実施例1~9の

構成と自由に組み合わせて実施することが可能である。
また、実施例10の電子機器の表示部として本実施例のE.L表示パネルを用いることは有効である。

【0141】〔実施例14〕本実施例では、実施例13に示した画素部において、E.L素子3505の構造を反転させた構造について説明する。説明には図18を用いる。なお、図16の構造と異なる点はE.L素子の部分と電流制御用TFTだけであるので、その他の説明は省略することとする。

【0142】図18において、電流制御用TFT3503はPTFTを用いて形成される。

【0143】本実施例では、画素電極（陰極）50として透明導電膜を用いる。具体的には酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物でなる導電膜を用いる。勿論、酸化インジウムと酸化スズとの化合物でなる導電膜を用いても良い。

【0144】そして、絶縁膜でなるバンプ51a、51bが形成された後、溶液塗布によりポリビニルカルバゾールでなる発光層52が形成される。その上にはカリウムアセチルアセトネート（acacKと表記される）でなる電子注入層53、アルミニウム合金でなる陰極54が形成される。この場合、陰極54がバッシュペーション膜としても機能する。こうしてE.L素子3701が形成される。

【0145】本実施例の場合、発光層52で発生した光は、矢印で示されるようにTFTが形成された基板の方に向かって放射される。

【0146】なお、本実施例の構成は、実施例1～9の構成と自由に組み合わせて実施することが可能である。また、実施例10の電子機器の表示部として本実施例のE.L表示パネルを用いることは有効である。

【0147】〔実施例14〕本実施例では、図17(B)に示した回路図とは異なる構造の画素とした場合の例について図19(A)～(C)に示す。なお、本実施例において、3801はスイッチング用TFT3802のソース配線、3803はスイッチング用TFT3802のゲート配線、3804は電流制御用TFT、3805はコンデンサ、3806、3808は電流供給線、3807はE.L素子とする。

【0148】図19(A)は、二つの画素間で電流供給線3806を共通とした場合の例である。即ち、二つの画素が電流供給線3806を中心に線対称となるように形成されている点に特徴がある。この場合、電源供給線の本数を減らすことができるため、画素部をさらに高精細化することができる。

【0149】また、図19(B)は、電流供給線3808をゲート配線3803と平行に設けた場合の例である。なお、図19(B)では電流供給線3808とゲート配線3803とが重ならないように設けた構造となっているが、両者が異なる層に形成される配線であれば、

絶縁膜を介して重なるように設けることもできる。この場合、電源供給線3808とゲート配線3803とで専有面積を共有させることができるため、画素部をさらに高精細化することができる。

【0150】また、図19(C)は、図19(B)の構造と同様に電流供給線3808をゲート配線3803と平行に設け、さらに、二つの画素を電流供給線3808を中心に線対称となるように形成する点に特徴がある。また、電流供給線3808をゲート配線3803のいずれか一方と重なるように設けることも有効である。この場合、電源供給線の本数を減らすことができるため、画素部をさらに高精細化することができる。

【0151】なお、本実施例の構成は、実施例1～9、11または12の構成と自由に組み合わせて実施することが可能である。また、実施例10の電子機器の表示部として本実施例の画素構造を有するE.L表示パネルを用いることは有効である。

【0152】〔実施例16〕実施例13に示した図17(A)、図17(B)では電流制御用TFT3503のゲートにかかる電圧を保持するためにコンデンサ3504を設ける構造としているが、コンデンサ3504を省略することも可能である。実施例12の場合、電流制御用TFT3503として実施例1～8に示すような本発明のNTFTを用いているため、ゲート絶縁膜を介してゲート電極に重なるように設けられたLDD領域を有している。この重なり合った領域には一般的にゲート容量と呼ばれる寄生容量が形成されるが、本実施例ではこの寄生容量をコンデンサ3504の代わりとして積極的に用いる点に特徴がある。

【0153】この寄生容量のキャパシタンスは、上記ゲート電極とLDD領域とが重なり合った面積によって変化するため、その重なり合った領域に含まれるLDD領域の長さによって決まる。

【0154】また、実施例14に示した図19(A)～(C)の構造においても同様に、コンデンサ3805を省略することは可能である。

【0155】なお、本実施例の構成は、実施例1～9、11～15の構成と自由に組み合わせて実施することが可能である。また、実施例10の電子機器の表示部として本実施例の画素構造を有するE.L表示パネルを用いることは有効である。

【0156】

〔発明の効果〕本発明により、電解めっき法で析出条件を設定することにより、容易にゲート配線の側面および上部に金属膜を析出させることができる。また、この金属膜をマスクとして島状半導体層に不純物元素を添加させ、LDD領域をゲート配線の両側に均一の幅で形成することができる。この結果、GOLD構造である半導体装置が得られるため、高耐圧、高信頼性のTFTを製作することができる。また、画素部の画素TFTに15～

20Vのゲート電圧を印加して駆動させても、安定した動作を得ることができる。その結果、結晶性TFTで作製されたCMOS回路を含む半導体装置、また、具体的には液晶表示装置やEL表示装置の周辺に設けられる駆動回路の信頼性を高め、長時間の使用に耐える液晶表示装置やEL表示装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 電解めっき法の簡略図。

【図2】 本発明によるTFTの作製工程を示す断面図。

【図3】 本発明によるTFTの作製工程を示す断面図。

【図4】 本発明によるアクティブマトリクス基板の作製工程を示す断面図。

【図5】 本発明によるアクティブマトリクス基板の作製工程を示す断面図。

【図6】 本発明によるアクティブマトリクス基板の作製工程を示す断面図。

【図7】 本発明によるアクティブマトリクス基板の作製工程を示す断面図。

【図8】 TFTの作製工程を示す断面図。

【図9】 TFTの作製工程を示す断面図。

【図10】 反強誘電性混合液晶の光透過率特性の一例を示す図。

【図11】 電気器具の一例を示す図。

【図12】 電気器具の一例を示す図。

【図13】 電気器具の一例を示す図。

【図14】 EL表示装置の構成を示す図。

【図15】 EL表示装置の構成を示す図。

【図16】 EL表示装置の構成を示す図。

【図17】 EL表示装置の構成を示す図。

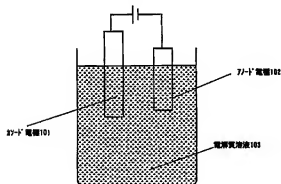
【図18】 EL表示装置の構成を示す図。

【図19】 EL表示装置の構成を示す図。

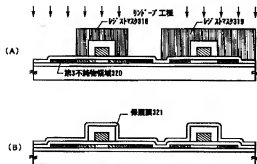
【図20】 TFTの作製工程を示す断面図。

【図21】 TFTの作製工程を示す断面図。

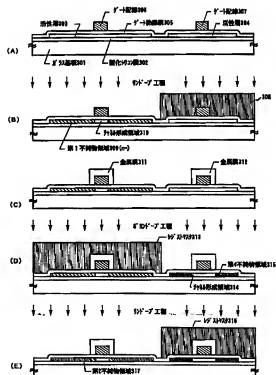
【図1】



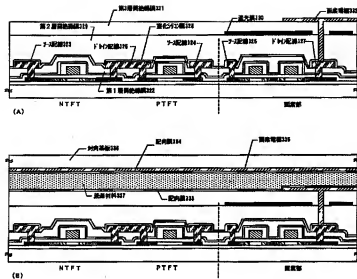
【図3】



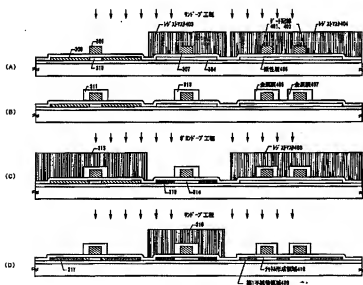
【図2】



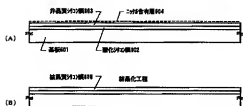
【図4】



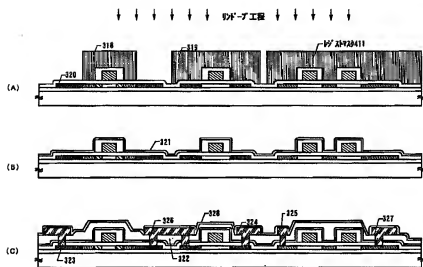
【図5】



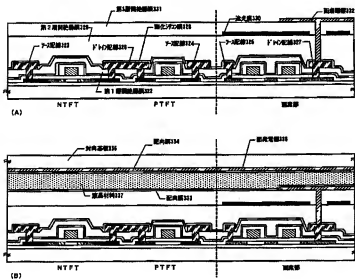
【図8】



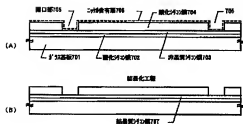
【図6】



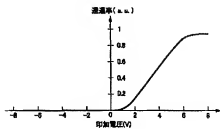
【図7】



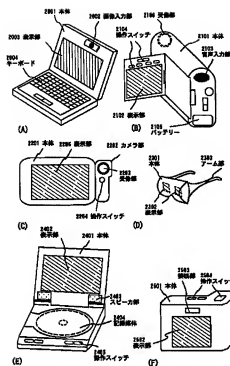
【図9】



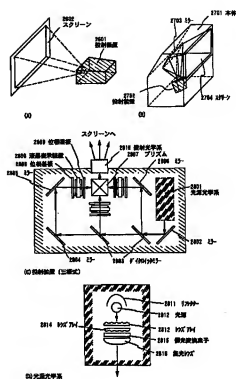
【図10】



【図11】



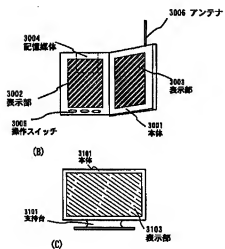
【図12】



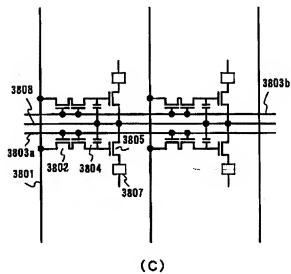
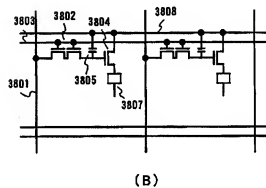
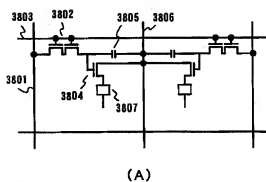
【図20】



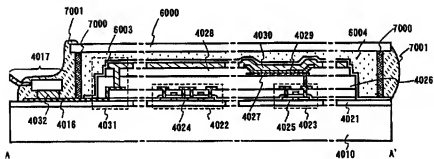
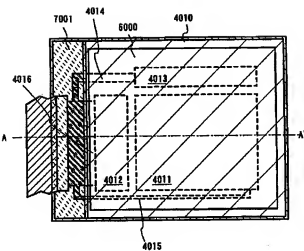
【図13】



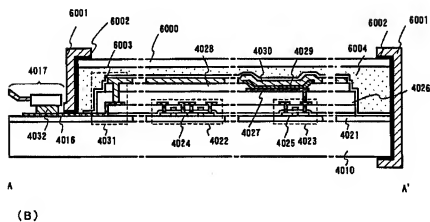
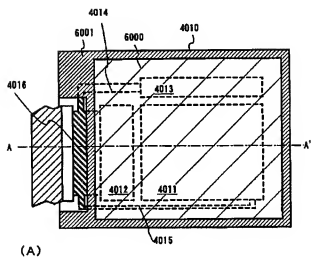
【図19】



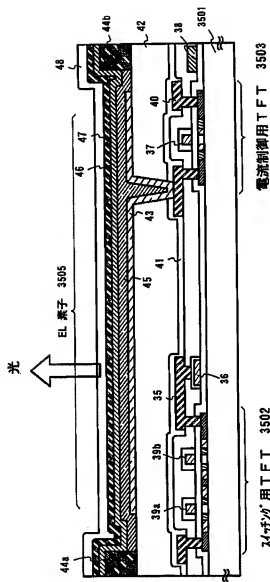
【图14】



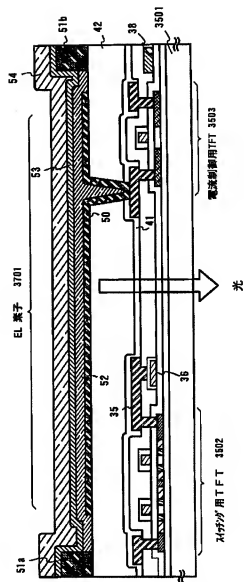
【図15】



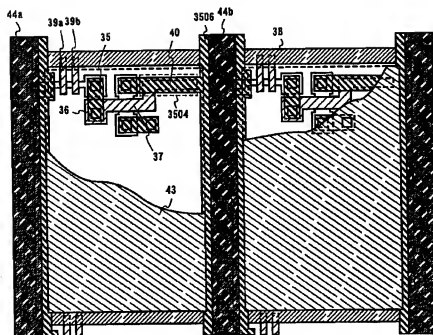
【図16】



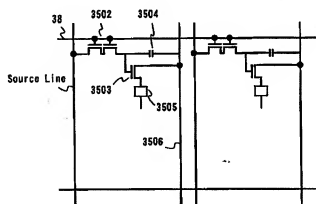
【図18】



【図17】



(A)



(B)

フロントページの続き

(51)Int. Cl.?

識別記号

FI

キーワード (参考)

H01L 21/3205

G02F 1/136

500

21/8238

H01L 21/88

R

27/092

27/08

321D

27/08

29/62

G

29/43

29/78

616A

21/336

617J

627G

331